





IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),  
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,  
MR, NE, SN, TD, TG).

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

添付公開書類:  
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

---

information of the reflecting plane under the conditions where the liquid LQ is supplied on the substrate stage PST as first information. The measurement process using the interferometer system is well performed and exposure is performed at high accuracy also in immersion exposure.

(57) 要約: 露光装置EXは、液体LQを介して基板Pを露光するものであって、基板Pを保持可能な基板ステージPSTと、基板ステージPST上の移動鏡に形成された反射面に測定光を照射するとともに、その反射光を受光して、基板ステージPSTの位置情報を計測する干渉計システム43と、基板ステージPST上に液体LQが供給された状態での反射面の誤差情報を第1情報として記憶するメモリMRYとを備えている。液浸露光においても、干渉計システムを使った計測処理を良好に行って精度良く露光できる。